講座

Lecture すべりに伴う物質の移動と変形 第6回

Displacement and deformation of the sliding materials No.6

ミクロのすべりと摩擦

Microscopic sliding and friction

松川 宏/青山学院大学理工学部物理数理学科

Hiroshi MATSUKAWA/Fac. of Sci. and Eng., Aoyama Gakuin University

キーワード:摩擦, 潤滑, 真実接触点, アモントン・クーロンの法則, ナノトライボロジー, 地震 Key words: friction, lubrication, actual contact point, Amoton-Coulomb's law, nanotribology,earthquake

1. はじめに

固体表面間のすべり摩擦はもっとも身近な物理現象の 一つであり、古代から多くの研究が成されてきた。そし て,次のクーロン-アモントンの法則という高校の物理 の教科書にも登場する経験則が広い範囲で成り立つこと があきらかになっている^{1~3)}。i)摩擦力は見かけの接 触面積によらない, ii) 摩擦力は荷重に比例する, iii) 動摩擦力は静摩擦力より小さく速度に依存しない。これ についてはよく知られるように, 真実接触面積は見かけ 上の接触面積に比べ極めて小さく,そのため真実接触点 での圧力は降伏応力という一定値に達しているため真実 接触面積は荷重に比例する, 真実接触点では分子間力に よる凝着がおこりこれを切るために必要な力が摩擦力で ある、といういわゆる凝着説に基づく説明があるわけで あるが、実は未だに諸説あり議論が続いている。この理 由としては、よく言われることであるが、摩擦は物質、 形状、表面状態、潤滑剤の有無等により、実に多様な様 相を示す複雑な現象である事が考えられる。しかし摩擦 力顕微鏡など近年の様々な実験手法および計算機の発達 によって、これまで調べられなかったミクロスケールの 摩擦など制御された環境下での摩擦の振る舞いが研究さ れている。摩擦力顕微鏡とは十分鋭い探針の先端で試料 表面を走査し,探針の位置における探針-試料間の摩擦 力を測定するもので,原子スケールの解像度が得られて いる。図-1に測定例を示す。そしてこれらのミクロス ケールの摩擦研究の成果は、マクロ系の研究にも活かさ れようとしている。

ここでは、ミクロスケールの研究の例として、乱れの ない清浄なグラファイト基盤とグラファイトフレーク間 の摩擦を紹介する^{3.5)}。もう一つの話題は超潤滑^{6~9)}と、 それと関連する新しいマクロ摩擦発生の機構¹⁰⁾について である。摩擦が起こっている滑り面をその場で観察でき れば、それは摩擦の研究に大きな進歩をもたらすだろう。 そのような試み^{11~13)}を概観したあと、真実接触点の振る 舞いとそれに関連する摩擦の待機時間、速度依存性^{14~18)} について紹介する。

2. グラファイト基盤とグラファイトフレーク間の摩擦

近年の実験技術、計算機の進歩によって制御された環 境下での様々な摩擦が調べられるようになった。そのよ うな研究の例として乱れの無い、あるいはその効果が弱 い、清浄表面間の摩擦がある。これは、ある意味、もっ とも単純な系の摩擦である。その対象として、典型的な 層状物質であり実験が比較的容易で、理論的数値的にも 扱いやすいグラファイトが用いられることが多い。グラ ファイトはもっともよく使われる固体潤滑剤の一つでも ある。固体潤滑剤としてのグラファイトはフレーク状に なっていると考えられる。そして、そのようなフレーク の表面は、まずは原子的なスケールで清浄だとみなせよ う。清浄グラファイト間の摩擦の研究はそのような固体 潤滑剤としてのグラファイトの基礎を明らかにするもの としても興味深い。また、グラファイトの摩擦力顕微鏡 実験においては、図-1(a)のMoS₂と同様に、グラファ イトの表面結晶構造を反映した明確な原子スケールの周 期的なスティックスリップ運動が観測されているが、そ れにもかかわらずアモントン-クーロンの法則と同じく 摩擦力は荷重に比例する¹⁹⁾。また、この場合の摩擦力の "地図"も図-1(b)と同様に得られており、そのパター ン自体200は摩擦力顕微鏡の探針を単原子としたモデルに 基づく計算機シミュレーションで良く再現されるが、そ のときのシミュレーションでの荷重の大きさは実験での それの1/100程度である²¹⁾。これらのことから、グラファ イトの摩擦力顕微鏡実験においては、基盤のグラファイ トから剥離したフレークが探針の先に張り付き、実はグ ラファイトフレークとグラファイト基盤間の摩擦を測定 しているのではないかとの指摘がある。清浄グラファイ ト間の摩擦の研究はそのような摩擦力顕微鏡実験の解釈 についても新しい光を当てることができよう。さらに最 近では意図的にグラファイトフレークを探針とグラファ イト基盤間に介在させた摩擦力顕微鏡実験も行われてい 3²²⁾

松下らはこれらの理由から,清浄グラファイト基盤と グラファイトフレーク間の摩擦の計算機実験を行った^{3.5)}。 フレークは100原子程度であり摩擦力顕微鏡の探針で駆



 図-1 (a) 摩擦力顕微鏡を使って得られたMoS₂の(0001) 表面とSi₃N₄でできた探針先端間の摩擦力。横軸は探 針の位置。(b)の下に示したX方向に走査している。 点線は逆方向に走査したときの摩擦力。周期的なの こぎり型の形がみえる。のこぎりの歯を上っていく 間は探針先端は試料表面のある位置にスティックし ており、そのため摩擦力は探針位置とともに増加す る。そして、"最大静摩擦力"に達したところでス リップし、摩擦力は急激に減少する。スティックス リップの周期はMoS₂の(0001)表面の滑り方向の 格子定数に一致する
(b) (a)の走査をゆっくりy軸方向にずらして行い、 得られた摩擦力の"地図"。摩擦力の大きさを明暗 で示す(文献4)より転載)

動されている。グラファイト基盤とフレークの配置の例 を図-2に示す。図-3にはx方向に探針を走査した場 合の得られた摩擦力を探針の位置の関数として示す。摩 擦力顕微鏡実験で観測されるのと同様のグラファイトの 表面結晶構造を反映した周期的な原子スケールのス ティックスリップ運動がみられる。最もスティック時間 の長い配置では、フレークは基盤と図-2に示したバル クグラファイトのA B積層構造を再現している。図-4 にxおよびy方向に走査した場合の静および動摩擦力の 荷重依存性を示す。ここで、静摩擦力はスティクスリッ



図-2 グラファイト基盤上のグラファイトフレークの配置 の例。破線は基盤の格子を,実線はフレークの格子 を表す



図-3 グラファイト基盤上のグラファイトフレークの摩擦 力。横軸は探針の座標



図-4 グラファイト基盤上のグラファイトフレークの静
(F_s)および動(F_k)摩擦力の荷重依存性。xおよび
y方向に駆動した場合

プ運動における最大の摩擦力,動摩擦力は時間平均の摩 擦力として定義している。図に示されるように,摩擦力 は荷重に線形に依存している。しかし,荷重0でも摩擦 力は0にならず,有限の凝着項が存在し,摩擦力=凝着 項+摩擦係数×荷重,という式で表される。これはクー ロンの破壊基準と同じ形である。このような有限の凝着 項はマクロ系の摩擦でも現れることがあるが,今のよう なミクロ系の摩擦では荷重自体が小さいため顕著になる ことが多い。しかし,今の場合はそれほど大きくはない。 今,フレークは基盤と全面接触しており,真実接触面積 は荷重によらない。それにもかかわらず摩擦力が荷重に 線形に依存する理由は、系が低荷重領域にあるためと考 えられる。摩擦力(F)の荷重(L)依存性は一般には $F = a + \mu L + bL^2 + \cdots > L$ のべき関数によって表すことが できるであろう。ここでaは凝着項であり μ は摩擦係数、 bは適当な定数である。低荷重では L^2 以降の項は十分小 さく無視でき摩擦力の荷重依存性は線形になるのである。 そしてその摩擦係数はy方向に走査した場合、0.0055で ありx方向に走査した場合は0.013である。これはMate らがグラファイトの摩擦力顕微鏡実験によって得た摩擦 係数0.012と極めて近い値である¹⁹。彼らはフレークが 介在している可能性を指摘しているが、このシミュレー ションは実験で得られた低い摩擦係数を定量的に再現し ており、その主張を裏付けるものとなっている。

さてこれまで、グラファイトのよい潤滑特性(低い摩 擦係数) はグラファイトの層状構造と, 弱い面間相互作 用によると考えられてきた。これは本当であろうか? もしそうなら、フレークではなく炭素単原子を、1原子 当たりの荷重をフレークの場合と同じにしてグラファイ ト基盤上を滑らしても、1原子当たりの摩擦力でみた場 合,フレークの場合と同じ程度の小さなものとなるはず である。なぜなら、このとき単炭素原子と基盤間の距離 はフレークと基盤間の距離と同程度であり、炭素単原子 が基盤から受ける力はフレーク中の単原子が基盤から受 ける力と同程度になるはずだからである。しかし、そう はならない。単原子を滑らせた場合、摩擦係数はフレー クの場合の10倍程度の大きさになってしまう。つまり、 グラファイトの低い摩擦係数は弱い面間相互作用による ものではないのである。では何が原因なのだろうか? それは結晶構造なのである。図-2からわかるように、 フレーク内の炭素原子位置にはA, Bの2種類がある。 図-5にフレークがx方向に駆動されて動くときの、フ レークが感じる単原子当たりの基盤ポテンシャルエネル ギー,およびA,Bの位置の炭素原子が感じるポテンシャ ルエネルギーを示す。フレークが基盤上を動くとき、こ の2種類の位置にある炭素原子の基盤からのポテンシャ ルエネルギーは振動するが、その振動の位相が180度ず



図-5 フレークが初期状態からx方向に駆動されて動くと きの、フレークが感じる単原子当たりの基盤ポテン シャルエネルギーV_{sub}/Nr、およびA、Bの位置の炭 素原子が感じるポテンシャルエネルギー、V^Asub、V^Gsub を示す

れるのである。その結果,フレーク全体が感じる基盤ポ テンシャルエネルギーは変化しなくなる。ポテンシャル エネルギー一定で動くのなら力は受けない。これはフ レーク,基盤,カンチレバーの変形などを無視した話で, 実際にはそれらの効果により有限の摩擦力が生じる。し かし,それは小さい。こうしてグラファイト間の摩擦係 数は極めて低い値となるのである。これが,グラファイ トがよい固体潤滑剤となる微視的機構と考えられる。

3. 超潤滑とマクロな摩擦の機構

さて,前節で述べた清浄グラファイト表面間の摩擦で は、フレークと基盤のグラファイトが、最もエネルギー の低い状態であるバルクのAB積層構造を再現する状態 から出発した。この状態は極めて安定であり、フレーク の回転に対して大きなエネルギー障壁が存在する。その ため、駆動中にもフレークは回転することなく、結晶軸 に沿って駆動した場合、周期的に元と同じ配置にもどる。 しかし,一般には清浄表面間の運動でも,周期的に元と 同じ配置に戻るとは限らない。というより、戻らない場 合のほうが圧倒的に多い。2つの清浄表面1,2の相対 運動を考え、その滑り方向の両者の格子定数a1, a2の比 a_1/a_2 に注目する。これが有理数でn/m (n, mは互いに 素な整数)と表すことができれば、1または2の結晶全 体を長さma1=na2だけずらせば、1と2の表面のお互 いの関係はずらす前と同じである。したがって,1の結 晶をだんだんとずらしていくと、移動距離 $ma_1 = na_2$ ご とに周期的に元と同じ配置に戻る。しかし、a1/a2が無 理数ならどれだけずらしても最初と同じ状態に戻ること はない。このようなとき、2つの結晶格子はインコメン シュレートであるという。そして、違う結晶の表面間で はもちろんのこと、同じ結晶でもその表面の面が違えば、 またさらにそれも同じでも結晶軸をずらしてやれば、一 般に滑り方向の2つの表面の格子定数の比は無理数とな る。このとき、並進の移動によって最初と同じ状態に戻 ることはない。全体としては元に戻ることはないのであ るが、しかし部分部分をみていると、移動前のある領域 の原子配置と限りなく同じに近い原子配置が移動後はど こか別の領域で必ず生じている。まず各原子に注目する。 図-6(a)はインコメンシュレートな2つの表面の配置の 模式図である。簡単のため結晶は1次元系とし, 2つの 結晶の一方の表面は十分固いとして変形を無視し、完全 に周期的に並んでいるとする。するとこの結晶表面と他 方の結晶中の原子の相互作用エネルギーは図のような周 期ポテンシャルで表すことができる。他方の結晶はバネ でつながった原子列で表す。バネは結晶内の原子間相互 作用を表す。実線の○が並進移動前の原子配列、破線の ○が移動後の原子配列である。移動後の原子1の周期ポ テンシャル上の位置は移動前の原子6とほとんど同じ, 移動後の8の位置は移動前の2とほとんど同じというよ うに、移動前の各原子と限りなく同じ配置を、移動後の



図-6 (a) インコメンシュレートな二つの清浄表面の模式
図。一方の結晶表面はそれが作る周期ポテンシャルで,他方の結晶はバネでつながった原子列で表している。並進移動前の原子配列が実線の〇,移動後のそれが破線の〇である。移動によって全エネルギーは変わらず一定となる。従って静摩擦力は働かない
(b) 二つの表面の原子間相互作用が強く一種の表面再構成を起こした状態。上の原子はポテンシャルの谷に落ち込んでしまっているため,上の原子列をずらそうとすると全体のポテンシャルエネルギーが上がってしまう。そのため有限の静摩擦力が働く

別の原子がしめる。よって移動によって周期ポテンシャ ルエネルギーを得する原子もあれば損する原子もあり, エネルギーの増減が打ち消しあい、系全体の表面間の原 子間ポテンシャルエネルギーは変わらない。ではバネで 表される同じ結晶内の原子間相互作用エネルギーはどう であろうか? これをみるためには原子列に注目する必 要がある。原子列でみても,図-6(a)で移動後の1,2,3 の原子列の配置は移動前の6,7,8の原子列とほとんど 同じである。同様に移動前の1~9の原子列配置に限り なく近い配置が移動後の別の領域で起こっている。この ように原子列でみても移動前と限りなく近い配置が移動 後のどこかで起こっている。よって同じ結晶内の原子間 相互作用も変わらない。周期的ポテンシャルで表される 表面間の原子間相互作用と、同じ結晶内の原子間相互作 用が移動の前後で変わらないのだから、全エネルギーは 変わらない。これは運動した距離によらない。全エネル ギーが並進移動によって変わらないのだから、並進運動 しても力を受けず、摩擦力は消えてしまう。これが平野 らによって提案された"超潤滑"の機構である。ここ で重要な有理数か無理数かというのはもちろん数学的概 念で,厳密には無限に大きな表面間でのみ意味がある。 しかし,実際には2つの格子定数の比が有理数でも簡単 なものでなければ無理数の場合とほとんど同じ振る舞い をし、有限な大きさの表面間でもある程度大きければ無 限系と変わらない。ここで議論している摩擦力とは静摩 擦力であり、動きがある限りエネルギーの散逸は存在し、 動摩擦力は働く。しかし、その大きさは速度の低下とと もに十分,小さくなる²³⁾。平野らは2枚の雲母間の摩擦 を測定し高真空環境下で結晶軸をそろえたコメンシュ レートな場合には大きな摩擦力が現れるものの、結晶軸 をずらしインコメンシュレートにした場合、極めて摩擦 力が小さくなることを示した"。同様の結論は、最近、 Niの(100) 面間でも得られている⁹。さらに平野らはSi

基盤と先の平らなWの針の間の摩擦を超高真空中で測定 し、摩擦力が消えることを実験精度の範囲内で確認して いる[®]。しかし二つの表面の原子配列がインコメンシュ レートなら常に静摩擦力が消えるとはいえない。2つの 表面の原子間相互作用が強くなれば、図-6(b)に示した ように、それを得するようにある種の表面再構成が起 こってしまう。一方の表面を構成する原子は他方の表面 原子が作るポテンシャルの谷底に落ちてしまうのである。 そこでは、一方の物質を動かそうとする場合、必ず、ポ テンシャルの山を登らねばならず、つまり得していた原 子間相互作用を切らねばならず、有限の静摩擦力が生じ る。二つの表面の原子間相互作用を徐々に強くしていっ た場合、それがある臨界値に達したところで、静摩擦力 が0の状態から有限の状態へ一種の相転移をすることが 理論的数値的にわかっている^{2,3,6,23)}。2つの表面の原子 間相互作用の強さは荷重とともに変わるから、この2つ の状態間は荷重を制御することにより移り変われる。た だし、この相転移は未だ実験では確認されていない。

さて、ここで話しをマクロな系の摩擦に移す。摩擦の 凝着説では、真実接触点での分子間力による凝着が摩擦 の原因と考えている。しかし、これに対して、最近、懐 疑が高まり、そしてその凝着を仮定しない全く新しい クーロン-アモントンの法則の説明まで現れた¹⁰⁾。そし てその懐疑は超潤滑に関連しているのである。まず簡単 のため、各真実接触点表面は原子的なレベルで平らであ り, 乱れは無いとしよう。接する2つの真実接触点表面 が同じ物質でできており、結晶方位もそろっていれば問 題は無い。しかし、一般にはそうはならず、2つの表面 の原子配置はインコメンシュレートとなる。問題はその ときの二つの表面の原子間相互作用の強さである。そし て幾つかの計算では、現実的なパラメーター領域では、 2つの表面の構造は再構成を起こさずインコメンシュ レート構造のままであると主張されている^{6,10}。つまり, 静摩擦力は消えてしまうのである。では乱れがあるとど うなるのか? この場合も運動に伴って2つの表面の原 子間相互作用を得する原子もあれば損する原子もあるこ とに変わりはない。しかし、この場合は少しでも乱れが あれば必ず有限の静摩擦力を生じることが理論的数値的 にわかっている²⁴⁾。ただし、その大きさは揺らぎのオー ダー、つまり相互作用する原子対の総数の平方根のオー ダーにしかならず,真実接触面積に比例した凝着力を与 えることはできないという主張がなされている10。では、 何故この世界では、荷重に比例したマクロな摩擦力が現 れるのだろうか? M. H. Musser, M. Robbinsらのグ ループは2つの真実接触点の間の動ける介在分子が重要 な役割を果たしていると主張している100。通常の摩擦実 験では、大気中の炭化水素、超高真空中でも不純物や摩 耗によって生じた分子クラスターがその介在分子となっ ていると考えられる。これらの介在分子は動けることが 重要であり、そのため全ての介在分子はエネルギーを得

する配置をとり、2つの真実接触点間にはこの介在分子 を介した相互作用の利得が生じる。2つの表面間に滑り を生じさせるためには、この介在分子をよりエネルギー の高い状態に移さねばならず、摩擦力が生じる。この摩 擦力は荷重に比例することがモデル計算で示されている。

以上はM. H. Musser, M. Robbinsらの主張である。 平野らの雲母間の摩擦実験ではインコメンシュレートな 条件でも大気圧で常温環境下では、摩擦力は大きくなる"。 これは超高真空、高温環境下では雲母表面の介在分子が 飛んでしまい、インコメンシュレートな清浄表面の条件 が実現されていたのが、大気圧、常温環境下では介在分 子が存在するのだと考えれば、M. H. Musser, M. Robbinsらの主張と矛盾しない。雲母と同様の振る舞いは最 近,Ni(100) 面間の実験でも見つかっている⁹。しかし, 彼らの議論には幾つかの問題点があり、未だに論争が続 いている。また最後に紹介する、これまで真実接触点と の関連で議論されてきた摩擦力の待機時間依存性、速度 依存性をどのように説明するのかも現時点では不明であ る。しかし、我々の日常生活に常に現れる摩擦の生じる 機構にも未だに確立した説明は無いということはいえる であろう。

4. 滑り面,滑り面間を見る

摩擦の基礎的機構はまだまだ解明されていない。これ についてはいろいろ理由があろうが、実験の立場から見 た場合、摩擦を起こしている正にその現場を見ることが できない、ということが大きなネックの一つになってい ると考えられる。通常の表面科学の問題であれば、表面 は真空中なり,ある雰囲気中に露出しており,様々な実 験手段を用いて、その構造を調べることが可能である。 しかし乾燥摩擦の場合,固体表面はもう一つの固体表面 と接しており、その正に接しているところで摩擦は起き ている。そして、接しているが故に、その場所の構造を 見ることが困難である。2つの固体表面間に潤滑剤が存 在する場合,その潤滑剤の構造,振る舞いが大きな問題 となるが、これも直接、観測することはこれまで困難で あった。しかし最近,これらの問題にも発展が起こりつ つある。イスラエルアチビリらによって開発された表面 力測定装置による極めて薄い潤滑剤の実験はよく知られ ている¹¹⁾。この装置では、2枚の半円筒上の雲母を軸を 直交させ凸面同士を近づける。雲母間には様々な "潤滑 剤"を配置し、この雲母を互いに滑らせることにより、 摩擦実験を行う。2枚の雲母間の間隔は光学的な干渉効 果を利用することにより精密に測定することができる。 この装置を用いた実験により、潤滑剤が十分子層以下に なると層の厚さが"量子化"される、つまりある一定値 の整数倍の値だけをとるようになること、さらに薄くな ると低速度で駆動されたとき系はスティックスリップ運 動を示すこと、等の現象が報告されている¹¹⁾。そしてこ れらの現象は、対応する計算機実験の結果を用いて、10 分子層以下で潤滑剤が層状構造を作り, さらに薄くなる と狭い領域に閉じこめられていることによりバルクのガ ラス転移温度や融点より高温でも, ガラス化, 固化を起 こし最大静摩擦力が現れスティックし、ここに応力が加 わると解けてスリップを起こすためである、と考えられ ている。最近このような数分子層の潤滑剤を閉じ込めた 系で、潤滑剤の構造を放射光X線を用いて直接測定する という実験が行われた120。そして、上記のような層状構 造を観測した。この実験では実際に応力を加えて滑らせ てはいない。一方, イスラエルアチビリらは表面力測定 装置と通常のX線散乱実験装置を組み合わせ、液晶を雲 母間にはさみ、応力を掛け滑らせることにより液晶の構 造が変化することを観測した¹³⁾。彼らはそこで用いた装 置をX線表面力測定装置と呼んでいるが、ここではX線 の散乱強度を稼ぐため、液晶の層厚は800µm程度と厚く しており、この装置の適用はそのような厚さでも現れる 現象に限られるようである。これらの実験はどれも、滑 り面間の潤滑剤の振る舞いを直接、観測することを目指 すもので、興味深い。今後の発展が期待される。

5. 真実接触点とマクロ系の摩擦

前節ではミクロ系の滑り面間の直接観測の試みについ て紹介したが、マクロな系の乾燥摩擦でも、滑り面の振 る舞いを直接見ようと言う努力がなされてきた。摩擦を 生じる個々の真実接触点を見る試みは、過去に、河野ら14, ダイエトリッヒら¹⁵⁾によって行われ,真実接触面積の待 機時間依存性などが明かにされ、後述する静摩擦力の待 機時間依存性,動摩擦力の速度依存性の機構との関連が 議論されてきた。しかし、そのような研究は多くはない。 最近,このようなマクロ系の摩擦での真実接触点の振る 舞いについて興味深い報告がバウムバーガーらによって 行われた¹⁶⁾。彼らはガラス上でゲルを滑らせ、その滑り 面をガラス側から光学的に同時観測するとともに、ゲル に横方向から光を当て、光弾性効果を用いて、ゲル内の 応力分布までを可視化して示した。この系では、駆動速 度が遅い場合,系全体としてスティックスリップ運動を 示す。彼らはこのスリップが滑り面全体で一様に起こる のではなく, 試料の一部の真実接触点 (ゲルの場合, 通 常の真実接触点とはちょっと違うが)が滑り、これがス リップパルスとなって伝わることにより、系全体がス リップする、スリップした領域はその後、近傍の応力が 緩和し再びガラスと接触するという現象を発見している。 これは、通常の固体での塑性変形が転位線の伝搬によっ て起こるのと極めて似ている。この現象がゲルに特有の ものなのか、より広い範囲で現れるものなのか、興味は 尽きない。

さて,紙や金属,岩石やゲルなど多くの系で,静摩擦 力が荷重を加えてから駆動力を加えて摩擦力を測定する までの時間(以降,待機時間と呼ぶ)に依存することや, 動摩擦力が速度に依存することが明らかにされている。 そして、その待機時間依存性や速度依存性が対数関数で 表される場合が多い^{17,18)}。まず、紙の場合についてみて みよう¹⁷⁾。このとき、最大静摩擦力はlog(待機時間)に 比例する。一方,動摩擦力の速度依存性も低速度(0.1 mm/sec程度以下)の場合は、-log(速度)に比例する。 そして両者の振る舞いは完全にスケールされてしまうの である。つまり速度の関数としての動摩擦力を動摩擦力 (速度),待機時間の関数としての最大静摩擦力を最大静 摩擦力(待機時間)と表すと、最大静摩擦力(待機時間) =動摩擦力(速度=ある長さ/待機時間)という関係が成 り立つのである。これは、動摩擦力の速度依存性と静摩 擦力の待機時間依存性を決める機構は同一であることを 示している。ではその機構とは何か? 上記のようにこ れまで数は多くないものの,摩擦面の真実接触点を直接 観察した実験が幾つか行われている。それらの研究では 透明な基盤ともう一方の試料の間の摩擦面を、透明基盤 側から光をあて、摩擦面での反射光¹⁴⁾、もう一方の試料 が透明な場合には透過光じを用いて観測し、真実接触面 積が評価されている。その結果、静止時の真実接触面積 は待機時間の対数に比例することがわかっている。これ が最大静摩擦力の待機時間依存性の原因であると考えら れる。一方,運動状態での真実接触面積の測定は無いも のの,各真実接触点は速度に反比例した平均寿命を持ち, 運動に伴い、真実接触点の組み替えが起こり、寿命がリ セットされると考えられる。そうすれば、運動時の真実 接触点の"待機時間"は速度に反比例することになり、 実験で観測されている最大静摩擦力と動摩擦力の関係は 説明できる170。岩石間の摩擦の場合には,最大静摩擦力 の待機時間依存性は紙の場合と同じであるが、動摩擦力 の速度依存性は、紙の場合と同じように速度とともに対 数関数的に減少する場合もあれば, 逆に増加する場合も ある。両者の振る舞いは圧力、温度などにより変わる。 速度とともに動摩擦力が減少する場合は系は動的に不安 定になり、スティックスリップ運動を起こすことになる。 断層のスティックスリップ運動は地震に他ならない。地 震の起こる深さには通常、ある限界値があり、それより 浅い場所でしか震源となり得ないが、それはこの岩石の 摩擦の速度依存性が圧力,温度によって変化することに より説明されている¹⁸⁾。では、この速度とともに対数関 数的に増大する振る舞いの原因はなんであろうか? そ れは熱揺らぎであると考えられている。最大静摩擦力よ りも小さい駆動力下でも、系は熱揺らぎによりわずかず つ動いている (クリープ運動)。この熱揺らぎの効果に より低速で駆動した場合,摩擦力は小さくてすむ。一つ 一つの真実接触点をみた場合、運動による真実接触点の 変形により生じる復元力がその真実接触点の降伏応力に 達する前に、熱揺らぎで結合が切れることが可能になる のである。しかし、そのためには熱揺らぎで結合が切れ るまで十分長い時間待たねばならない。そのため高速で 駆動したときは、熱揺らぎの効果はほとんど効かず、摩

擦力は増大するのである。このとき摩擦力はlog(速度) に比例することが理論的にわかっている¹⁷⁾。そして,こ の効果と先に述べた真実接触面積の変化の効果のどちら が支配的かによって,速度とともに動摩擦力は増大する か,減少するかが決まり,岩石の場合は,それが温度, 圧力により変わるのである。

この小論が最近の摩擦の基礎的研究にも興味を持って 頂くきっかけになれば幸いである。

参考文献

- 1) B. N. J. Persson (2000): "Sliding Friction Physical Principles and Applications , 2nd Editon" (Springer).
- 2) 松川宏 (2003): 日本表面科学会誌, Vol. 24. p. 328.
- 3) 松川宏 (2004):トライボロジスト, Vol.49, No.1, p.9.
- 4) S. Fujisawa, E. Kishi, Y. Sugawara and S. Morita (1994) : Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 33, p. 3752.
- 5) 松下勝義(2003):大阪大学大学院理学研究科博士論文;K. Matsushita, H. Matsukawa and N. Sasaki (2003):cond-mat/ 0307474.
- M. Hirano and K. Shinjo (1990): Phys. Rev. B, Vol. 47 p. 11837; 平野元久: 日本表面科学会誌, Vol. 24, p. 334.
- 7) M.Hirano, K.Shinjo, R.Kaneko and Y.Murata (1992): Phys. Rev. Lett., Vol. 67, 2642.
- M.Hirano, K.Shinjo, R.Kaneko and Y.Murata (1997) : Phys. Rev. Lett., Vol. 78, 1448.
- 9) J. S. Ko and A. J. Gellman (2000) : Langmuir, Vol. 16, 8343.
- G. He, M. H. Musser and M. O. Robbins (1999) : Science, Vol. 284, p. 50; M. H. Musser, L. Wenning and M. O. Robbins (2001) : Phys. Rev. Lett., Vol. 86, p. 1295.
- J. N. Israelachvili (1992) : Surf. Sci. Rpt. Vol. 14, p. 109 ; H. Yoshizawa, J. N. Israelachvili (1993) : J. Phys. Chem., Vol. 97, p. 11300.
- 12) O. H. Seeck, H. Kim, D. R. Lee, D. H. Shu, I. D. Kaendler, J. K. Basu and S. K. Sinha (2002) : Europhys. Lett., Vol. 60, p. 376.
- 13) Y. Golan, A. Martin-Herranz, Y. Li, C. R. Safinya and J. Israelachivili (2001) : Phys. Rev. Lett., Vol. 86, p. 1263.
- 14) 河野彰夫 (1988): 日本物理学会誌, Vol. 43, p. 579.
- 15) J. H. Dieterich and B. D. Kilgore (1994) : Pure and Applied Geophysics, Vol. 143, p. 283.
- 16) T. Baumberger, C. Caroli and O. Ronsin (2002) : Phys. Rev. Lett., Vol. 88, p. 075509.
- 17) F. Heslot, T. Baumberger, B. Perrin, B. Caroli and C. Caroli (1994) : Phys. Rev. E, Vol. 49, p. 4973; T. Baumberger (1997); Solid State Commun., Vol. 102, p. 175.
- 18) C. C. Scholz (1990): "The Mechanics of Earthquakeand Faulting", (Cambridge Univ Press 1990)(邦訳"地震と断層 の力学"(古今書院1993)).
- C. M. Mate, G. M. McClelland, R. Enlandsson and S. Chiang (1987) : Phys. Rev. Lett., Vol. 59, p. 1942.
- 20) S. Fujisawa, K. Yokoyama, Y. Sugawara and S.Morita (1998) : Phys. Rev. B, Vol. 58, p. 4909.
- N. Sasaki, M. Tsukada, S. Fujisawa, Y. Sugawara, S. Morita and K. Kobayashi (1997, 1998) : J. Vac. Sci. Technol. B, Vol. 15, p. 1479, Phys. Rev. B Vol. 57, p. 3785.
- 22) K. Miura and S. Kamiya (2002) : Europhys. Lett., Vol. 58, p. 610.
- 23) H. Matsukawa and H. Fukuyama (1994) : Phys.Rev. B, Vol. 49, p. 17286; T. Kawaguchi and H. Matsukawa (1997, 1998) : Phys. Rev. B Vol. 56, p. 13932, Vol. 58, p. 15866.
- 24) T. Kawaguchi and H. Matsukawa (1997, 2000, 2000) : Phys. Rev. B, Vol. 56, p. 4261, Vol. 61, p.R16366, Tribology Letters Vol. 9, p. 105.

⁽原稿受付2005年1月13日, 原稿受理2005年2月26日)